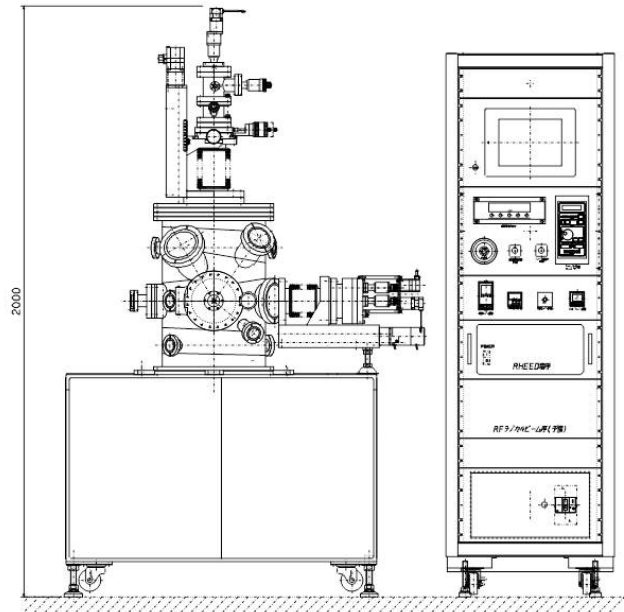




型式: PLD-202-2

PLD 装置

Pulsed Laser Deposition System



装置の詳細仕様、バリエーションに関してはお気軽にお問合せ下さい。

装置名称	PLD 装置 (スタンダード, PBNヒーター加熱)	備考
型式	PLD-202-2	
仕様	成膜室: 寸法340(ID)X500(H) mm, 電解研磨	シースヒーター巻き
	ターゲット: φ1"×5個, 自公転機構(汚れ防止有)	寸法、数量調整可能
	ヒーター: 耐酸化PBNヒーター, 温度1200°C以上	他の加熱方式選択可能
	基板: サイズφ1", 温度900以上, 5軸マニピュレータ	基板サイズ変更可能
	成膜室真空度: 5X10 ⁻⁶ Pa以下	真空ポンプ変更可能
	ガス導入系: MFC+ストップバルブ, 2系統	必要に応じて変更可能
	オプション: ロードロック機構, RHEED及び解析システム, RFラジカル源, 成膜ソフト, 放射温度計等	
設置及電源	外観寸法: 150(W)X120(D)X200(H) cm 電源: 単相 200V 60A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com